ダイヤモンド薄膜を用いた電子源ビームカレントの増幅

西谷智博,峰原英介,羽島良一,飯島北斗 日本原子力研究所 自由電子レーザー研究グループ

次世代自由電子レーザー用光陰極電子銃 NEA-GaAsフォトカソードからの電子放出 NEA-ダイヤモンドを用いた電流増幅 まとめ

次世代自由電子レーザー(FEL):XFEL、ERL-FELの実現





原研NEA-GaAsフォトカソード電子銃の開発

負電子親和性表面(Negative Electron Affinity -NEA-)



```
NEA-GaAsフォトカソードの利点
```



NEA-GaAsフォトカソードの問題



NEA surface

* NEA表面はCs、Ga原子から なる数Åオーダー程度の厚さ

問題 量子効率制限問題 (バルクGaAsで量子効率10%) 厳しい表面維持条件 極高真空(<~10⁻¹²Torr)が必要 厳しいNEA活性化条件 清浄表面の導出 Csのアノード電極付着が原因となる 電界放出暗電流(イオンバックボンバードメント)

NEA表面を持つダイヤモンドによる光電流の増幅





フォトカソードから放出した光電流をダイヤモンドを通し電流を増幅

→Ben-Zvi氏によりダイヤモンドの二次電子増幅効果を 用いたK2CsSbフォトカソードRF電子銃の提案

NEA表面を持つダイヤモンドからの二次電子放出



ダイヤモンドを用いた電流増幅試験

3つのサンプルについての電流増幅効果の確認 →サンプル-電子源間距離、電圧の依存性 (増幅効果の最適値を探る)



ダイヤモンド薄膜テストサンプル

結晶条件の違う3つのサンプル (表面形状、薄膜層厚、ドーピング) 以下の3つのテストダイヤモンドサンプルに ついて試験を行う。



サンプル I 層厚=~50 *μ* m B doped 水素終端表面





サンプル Ⅱ 層厚=~130 *μ* m B doped 水素終端表面

*写真は電子顕微鏡による表面観察





サンプルⅢ 層厚=250µm non-doped

まとめ

次世代自由電子レーザーの電子源として NEA-GaAsフォトカソード電子銃の開発

